

初級

半導体製造体験

今年は
2回開催

令和6年11月18日(月) 10:00~17:00

令和6年11月25日(月) 10:00~17:00

11月18日と11月25日は同じ内容です
どちらかをお申し込みください

半導体の製造におけるリソグラフィ工程（レジスト塗布/露光・現像/エッチング）を九州大学のクリーンルームにて1日で体験します。半導体関連業務に従事していても実際の製造現場を知らない方にお勧めします。

講師

九州大学 システム情報科学研究院
情報エレクトロニクス部門 電子デバイス工学 准教授 **佐道 泰造 氏**

【概要】PチャネルMOSFETをシリコン基板上に集積化した論理回路(NAND)を例題として取り上げ、集積回路(IC)製造プロセスの一部(リソグラフィ工程)を行うとともに、MOSFETと論理回路の動作特性を計測・評価します。

1. IC製造プロセス（講義）

2. 実習に用いる装置・材料の説明（講義）

3. IC製造（実習）

- クリーンルームにて
- (1) レジスト塗布
- (2) 露光・現像
- (3) エッチング



4. ICの計測（実習）

- (1) MOSFETのしきい値電圧の評価
- (2) NAND回路の動作特性の計測
- 5. データ整理とまとめ
- PC（センターで準備）を使ってデータ整理を行い、発表していただきます



※一部変更になる場合がございます

※実習について、「3. IC製造（実習）」と「4. ICの計測（実習）」とは2グループに分かれて午前と午後で実習内容を入れ替えながら実施します。

※クリーンルームでは防塵服を着用します。手続き簡略化のためサイズはLL(身長~182cm、胸囲~112cm)に統一させていただきます。なお防塵服着用のためスカートでの参加はご遠慮ください。

開催日

① 令和6年11月18日(月) 10:00~17:00

開催形態

対面のみ

② 令和6年11月25日(月) 10:00~17:00

定員

① 8名 ② 8名

①,②どちらかをお申し込みください

受講料

税込 **33,000円**

- 申込みには、「ふくおかIST e-learning」への会員登録が必要です
- お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません
- 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります
- 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止又は延期する場合がございます

会場

〒819-0395 福岡市西区元岡744
九州大学伊都キャンパス ウエスト2号館
5階 547号室(第2会議室)

お申し込み方法

- お申し込み期間は9月2日(月) 9:00 から 2024年11月13日(水) 17:00 まで -



下記HPより「2024年11月18日開催 半導体製造体験」または「2024年11月25日開催 半導体製造体験」を選択してお申し込みください

<https://e-learning.ist-college.org/contents/category/seminar-live>

ふくおかIST e-learning 検索 ➡ 「講座・セミナー等申込」をクリック

【本講座に関するお問い合わせ】 公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 福岡半導体リスキリングセンター 担当:高倉
e-mail : reskilling_contact@ist.or.jp TEL : 092-822-1550

この講座でお使いいただけます！

福岡県内中小企業の方は

(消費税及び地方消費税を除く)

受講料全額補助！！

補助には条件がございます。
お申込みの前に福岡半導体リスキリングセンターのホームページより、申請要領・交付要綱をご確認ください。
「ふくおかIST e-learning」の講座申込画面からもリンクでジャンプできます。

